

- 日時: 2016年6月17日(金) 13:30～17:00 (受付開始 13:00～)
- 会場: エッサム神田ホール2号館 6F 中会議室 (601) (JR神田駅より徒歩5分)
- 主催: 株式会社プリス、スペクトリス株式会社マルバーン事業部
- 定員: 70名 ●参加費: 無料

スプレードライメーカーのプリスと粒子分析装置メーカーのマルバーンはこれまで、製造(Manufacture)と工程(Process)にかかわる製造工程の解析に関する各種取り組みの共同研究を実施してきました。本セミナーでは、これまでの共同研究の結果を発表するとともに、さらに新しい展開を提案します。

セラミックスの原料製造を軸にした事例紹介ですが、以下の方に最適です。

- * 生産技術、製造技術研究、工業化研究に関わる方
 - * スプレードライ製造工程全般、装置、製造概要に興味ある方、あるいはお困りの方
 - * オン・インラインで「粒度分布」を測定する技術に興味ある方
 - * 粒子計測・粉体流動性により、プロセスの挙動を「解釈」する、ということにご興味をお持ちの方
- 適応可能なアプリケーション: セラミックス、電極材、食品製造、化学一般、医薬品など

13:30～13:40	ご挨拶
13:40～14:30	<p>[共同研究成果発表] リアルタイム粒度分布測定装置を実装したスプレードライシステムの紹介とセラミックス製造への適用事例 株式会社プリス</p> <p>スプレードライヤーとは、原液を瞬時に粒子にすることが可能な乾燥装置です。スプレードライを行うことで、目的に合致した希望通りの粉体を得ることができますが、そこには様々な条件検討が必要になります。粉体の特性を示す基本的かつ重要な指標は、「粒子径」ですが、従来、粒子径については、乾燥後の粒子をサンプリングし、オンラインで間欠的に評価がなされてきました。本セッションでは、リアルタイム粒子分析技術を組み込んだ新しいシステムの共同研究成果を発表します。</p>
14:30～15:20	<p>[共同研究成果発表] リアルタイム粒度分布測定技術の意義と基礎技術およびその応用 スペクトリス株式会社 マルバーン事業部(プロセスチーム)</p> <p>近年、ますます粒子・粉体を原料として用いた最終製品への要求が高くなってきています。歩留まりの向上やエラーの排除のため、「リアルタイム」での粒子分析技術は、それらの要求に応える技術として非常に有用です。本セッションでは、共同研究を基にした化学工学的な解析について紹介します。</p>
15:20～15:30	休憩
15:30～16:20	<p>[共同研究成果発表] 粒子計測技術を軸にしたプロセス挙動の解析と予測 スペクトリス株式会社 マルバーン事業部(ラボ評価チーム)</p> <p>粒子の製造工程の評価に、実験室レベルでの分析は重要ですが、製造工程を評価するフレームワークは意外に複雑です。より正確な評価には複数のパラメータが必要になります。本セッションでは、いくつかのモデルや、新しい計測法など、共同研究をもとにした解析結果を紹介します。</p>
16:20～16:30	質疑応答
16:30～	閉会后、個別にご質問をさせていただきます(希望者のみ)

※上記講演内容は予定であり予告なく変更させていただきます。

会場地図



【お申込方法】

次ページのセミナー参加申込書にご記入の上、FAXでお申込み下さい。

お申込先 FAX: **044-322-7787**

【お問合せ】

株式会社プリス
乾燥機械部 川口 宛
TEL: 044-328-7665

Manufacture & Process (M&P) 粒子計測セミナー 申込書

FAX送付先:044-322-7787

セミナー事務局:株式会社プリス 乾燥機械部 川口 宛

東京会場 2016年6月17日(金) 13:30~17:00

貴社名		
御住所		〒
1人目	御所属	
	氏名	
	TEL	
	E-Mail	
2人目	御所属	
	氏名	
	TEL	
	E-Mail	
3人目	御所属	
	氏名	
	TEL	
	E-Mail	

お申込が届きましたら、申込受領のメールをお送りさせていただきます。

個人情報の取扱について

- ◆ご記入いただいた個人情報は、本セミナーに関するお客様へのご連絡、情報提供や営業活動などを目的として利用いたします。
- ◆当該個人情報は、株式会社プリス、スペクトリス株式会社、各社以外の第三者には一切提供いたしません。
- ◆お客様ご自身の個人情報に関する照会や訂正、追加、または削除については、お客様ご本人から別途ご連絡いただくことにより合理的な期間および範囲内で対応させていただきますので、セミナー事務局までご連絡ください。